

## SECCIÓN G — SECCION G — FISICA

**G03 FOTOGRAFIA; CINEMATOGRAFIA; TECNICAS ANALOGAS QUE UTILIZAN ONDAS DISTINTAS DE LAS ONDAS OPTICAS; ELECTROGRAFIA; HOLOGRAFIA [4]**

**G03F PRODUCCION POR VIA FOTOMECANICA DE SUPERFICIES TEXTURADAS, p. ej. PARA LA IMPRESION, PARA EL TRATAMIENTO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES; MATERIALES A ESTE EFECTO; ORIGINALES A ESTE EFECTO; APARELLAJE ESPECIALMENTE ADAPTADO A ESTE EFECTO** (aparatos de composición fototipográfica B41B; materiales fotosensibles o procesos para la fotografía G03C; electrofotografía, capas sensibles o procesos a este efecto G03G)

**Nota(s) [5]**

En la presente subclase, las expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado:

- "fotosensible" significa no solamente sensible a una radiación electromagnética, sino también a una radiación corpuscular;
- "composición fotosensible" cubre las sustancias fotosensibles, p. ej. quinonadiazidas y, en su caso, los aglutinantes o aditivos;
- "materiales fotosensibles" cubre las composiciones fotosensibles, p. ej. las fotorreservas, sus soportes y, en su caso, las capas auxiliares.

**1/00 Originales para la producción por vía fotomecánica de superficies texturadas, p. ej. mascarar, foto-mascarar o reticular; Máscara en blanco o películas para ello; Contenedores especialmente adaptados a este efecto; Su preparación. [1, 3, 2006.01, 2012.01]**

**Nota(s) [2012.01]**

La presente clase, se aplica la regla del primer lugar, es decir, en cada nivel jerárquico, salvo que se indique lo contrario, la clasificación se realiza en el primer lugar apropiado.

- 1/20 . Máscaras o máscaras vacías para imagen por haz de partículas cargadas [CPB] radiación, p. ej. por haz de electrones; Su preparación [2012.01]
- 1/22 . máscaras o máscaras vacías para imagen por radiación de 100 nm o longitud de onda inferior, p. ej. máscaras de rayos X, máscaras de ultra-violeta extremo [EUV]; Su preparación [2012.01]
- 1/24 . . Máscaras de reflexión; Su preparación [2012.01]
- 1/26 . Máscaras de desplazamiento de fase [PSM]; PSM en blanco; Su preparación [2012.01]
- 1/28 . . con tres o más fases diversas en el mismo PSM; Su preparación [2012.01]
- 1/29 . . Bordes o estabilizadores PSM; Su preparación [2012.01]
- 1/30 . . Alternando PSM, p. ej. PSM Levenson-Shibuya; Su preparación [2012.01]
- 1/32 . . Atenuando PSM [att-PSM], p. ej. medio tono PSM o PSM con parte de desplazamiento de fase semi-transparente; Su preparación [2012.01]
- 1/34 . . Fase avanzada PSM, p. ej. PSM sin cromo; Su preparación [2012.01]
- 1/36 . Máscaras que poseen características de corrección por proximidad; Su preparación, p. ej. procesos de diseño para corrección de proximidad óptica [OPC] [2012.01]
- 1/38 . Máscaras que poseen características auxiliares, p. ej. recubrimientos especiales o marcas de alineación o de prueba; Su preparación [2012.01]

- 1/40 . . Características relacionadas con descarga eletrostática [ESD], p. ej. recubrimientos antiestáticos o una capa de metal conductor alrededor del sustrato de la máscara [2012.01]
- 1/42 . . Características de alineación o de registro, p. ej. marcas de alineación de los sustratos de la máscara [2012.01]
- 1/44 . . Características de pruebas o medida, p. ej. patrones de rendija, monitores de enfoque, escala de diente de sierra o dentada [2012.01]
- 1/46 . . Recubrimientos antirreflectantes [2012.01]
- 1/48 . . Revestimientos de protección [2012.01]
- 1/50 . Máscaras vacías no cubiertos por los grupos G03F 1/20-G03F 1/26; Su preparación [2012.01]
- 1/52 . Reflectores [2012.01]
- 1/54 . Absorbentes, p. ej. materiales opacos [2012.01]
- 1/56 . . Absorbentes orgánicos, p. ej. foto-resistentes [2012.01]
- 1/58 . . con dos o más capas de absorción diferentes, p. ej., capas de absorbentes apiladas [2012.01]
- 1/60 . Sustratos [2012.01]
- 1/62 . Películas o agrupación de películas, p. ej. con la membrana en la estructura de apoyo; Su preparación [2012.01]
- 1/64 . . caracterizado por los marcos, p. ej. estructura o material de la misma [2012.01]
- 1/66 . Recipientes especialmente adaptados para las máscaras, máscaras vacías o películas; Su preparación [2012.01]
- 1/68 . Procesos de preparación no cubiertos por los grupos G03F 1/20-G03F 1/50 [2012.01]
- 1/70 . . Adaptación de la capa básica o el diseño de máscaras para los requerimientos de proceso litográfico, p. ej. corrección de la segunda iteración de la máscara patrón para imágenes [2012.01]
- 1/72 . . Reparación o corrección de los defectos de la máscara [2012.01]
- 1/74 . . . por haz de partículas cargadas [CPB], p. ej. haz de iones enfocado [2012.01]
- 1/76 . . Patrones de máscaras por imagen [2012.01]

- 1/78 . . . por haz de partículas cargadas [CPB], p. ej. haz de electrones [2012.01]
- 1/80 . . . ataque químico [2012.01]
- 1/82 . . . Procesos auxiliares, p. ej. limpieza [2012.01]
- 1/84 . . . Inspección [2012.01]
- 1/86 . . . . por haz de partículas cargadas [CPB] [2012.01]
- 1/88 . . . preparado por los procesos fotográficos para la producción de originales simulando relieve [2012.01]
- 1/90 . . . preparado para los procesos de montaje [2012.01]
- 1/92 . . . preparado a partir de superficies de impresión [2012.01]
- 3/00 Separación de colores; Corrección de tonos**  
(dispositivos de reproducción fotográfica en general G03B) [1, 2006.01]
- 3/02 . . . por retoque [1, 2006.01]
- 3/04 . . . por medios fotográficos [1, 2006.01]
- 3/06 . . . por enmascarado [1, 2006.01]
- 3/08 . . . por medios fotoeléctricos [1, 2006.01]
- 3/10 . . . Verificación de colores o de tonos de los negativos o positivos de selección [1, 2006.01]
- 5/00 Procesos de la trama; Tramas con este fin** [1, 2006.01]
- 5/02 . . . por métodos de proyección (aparatos fotográficos G03B) [1, 2006.01]
- 5/04 . . . cambiando el efecto de la trama [1, 2006.01]
- 5/06 . . . cambiando el efecto de diafragma [1, 2006.01]
- 5/08 . . . utilizando tramas lineales [1, 2006.01]
- 5/10 . . . utilizando tramas de líneas cruzadas [1, 2006.01]
- 5/12 . . . utilizando otras tramas, p. ej. tramas granuladas [1, 2006.01]
- 5/14 . . . por métodos de contacto [1, 2006.01]
- 5/16 . . . utilizando tramas de semitono grises [1, 2006.01]
- 5/18 . . . utilizando tramas de semitono coloreadas [1, 2006.01]
- 5/20 . . . utilizando tramas para la impresión del grabado [1, 2006.01]
- 5/22 . . . combinando varias tramas; Eliminación del muaré [1, 2006.01]
- 5/24 . . . por exposiciones múltiples, p. ej. procesos combinados de fotografía de trazo y tramado [1, 2006.01]
- 7/00 Producción por vía fotomecánica, p. ej. fotolitográfica, de superficies texturadas, p. ej. superficies impresas; Materiales a este efecto, p. ej. conllevando fotorreservas; Aparellaje especialmente adaptado a este efecto** (utilizando estructuras de fotorreservas para procesos de producción particulares, ver en los lugares adecuados, p. ej. B44C, H01L, p. ej. H01L 21/00, H05K) [1, 3, 5, 2006.01]
- 7/004 . . . Materiales fotosensibles (G03F 7/12, G03F 7/14 tienen prioridad) [5, 2006.01]
- 7/008 . . . Azidas (G03F 7/075 tiene prioridad) [5, 2006.01]
- 7/012 . . . . Azidas macromoleculares; Aditivos macromoleculares, p. ej. aglutinantes [5, 2006.01]
- 7/016 . . . Sales de diazonio, o bien compuestos de ellas (G03F 7/075 tiene prioridad) [5, 2006.01]
- 7/021 . . . . Compuestos de diazonio macromoleculares; Aditivos macromoleculares, p. ej. aglutinantes [5, 2006.01]
- 7/022 . . . Quinonadiazidas (G03F 7/075 tiene prioridad) [5, 2006.01]
- 7/023 . . . . Quinonadiazidas macromoleculares; Aditivos macromoleculares, p. ej. aglutinantes [5, 2006.01]
- 7/025 . . . Compuestos fotopolimerizables no macromoleculares que contienen triples enlaces carbono-carbono, p. ej. compuestos acetilénicos (G03F 7/075 tiene prioridad) [5, 2006.01]
- 7/027 . . . Compuestos fotopolimerizables no macromoleculares que contienen dobles enlaces carbono-carbono, p. ej. compuestos etilénicos (G03F 7/075 tiene prioridad) [5, 2006.01]
- 7/028 . . . . con sustancias que aumentan la fotosensibilidad, p. ej. fotoiniciadores [5, 2006.01]
- 7/029 . . . . Compuestos inorgánicos; Compuestos de onio; Compuestos orgánicos que contienen heteroátomos diferentes del oxígeno, nitrógeno o azufre [5, 2006.01]
- 7/031 . . . . Compuestos orgánicos no cubiertos por el grupo G03F 7/029 [5, 2006.01]
- 7/032 . . . . con aglutinantes [5, 2006.01]
- 7/033 . . . . siendo los aglutinantes polímeros obtenidos por reacciones que hagan intervenir únicamente enlaces insaturados carbono-carbono, p. ej. polímeros vinílicos [5, 2006.01]
- 7/035 . . . . siendo los aglutinantes poliuretanos [5, 2006.01]
- 7/037 . . . . siendo los aglutinantes poliamidas o poliimidas [5, 2006.01]
- 7/038 . . . Compuestos macromoleculares que se vuelven insolubles o selectivamente mojables (G03F 7/075 tiene prioridad; azidas macromoleculares G03F 7/012; compuestos macromoleculares de diazonio G03F 7/021) [5, 2006.01]
- 7/039 . . . Compuestos macromoleculares fotodegradables, p. ej. reservas positivas sensibles a los electrones (G03F 7/075 tiene prioridad; quinonadiazidas macromoleculares G03F 7/023) [5, 2006.01]
- 7/04 . . . Cromatos (G03F 7/075 tiene prioridad) [1, 5, 2006.01]
- 7/06 . . . Sales de plata (G03F 7/075 tiene prioridad) [1, 5, 2006.01]
- 7/07 . . . . para difusión por transferencia [5, 2006.01]
- 7/075 . . . Compuestos que contienen silicio [5, 2006.01]
- 7/085 . . . Composiciones fotosensibles caracterizadas por los aditivos macromoleculares que aumentan la adherencia (G03F 7/075 tiene prioridad) [5, 2006.01]
- 7/09 . . . caracterizadas por detalles de estructura, p. ej. soportes, capas auxiliares (soportes para placas de impresión en general B41N) [5, 2006.01]
- 7/095 . . . . teniendo más de una capa fotosensible (G03F 7/075 tiene prioridad) [5, 2006.01]
- 7/105 . . . . con sustancias, p. ej. indicadores, para obtener imágenes visibles [5, 2006.01]
- 7/11 . . . . con capas de recubrimiento o capas intermedias, p. ej. capas de anclaje [5, 2006.01]
- 7/115 . . . . con soportes o capas con medios para obtener un efecto de filtro o para aumentar el contacto en la reproducción al vacío [5, 2006.01]
- 7/12 . . . Producción de formas de impresión para serigrafía o de formas de impresión similares, p. ej. clichés de multicopista. [1, 2006.01]
- 7/14 . . . Producción de formas de impresión para colotipia [1, 2006.01]

- 7/16 . . Procesos de recubrimiento; Aparellaje con este fin (aplicación de capas sobre los materiales soporte en general B05; aplicación de capas fotosensibles sobre el soporte para la fotografía G03C 1/74) [**1, 2006.01**]
- 7/18 . . . Recubrimiento de superficies curvadas. [**1, 2006.01**]
- 7/20 . . Exposición; Aparellaje a este efecto (dispositivos de reproducción fotográfica de copias G03B 27/00) [**1, 4, 2006.01**]
- 7/207 . . . Dispositivos de enfoque, p. ej. automático (posicionamiento y enfoque combinados G03F 9/02; sistemas para la generación automática de señales de enfoque G02B 7/28; dispositivos de enfoque para la reproducción fotográfica G03B 27/34) [**4, 2006.01**]
- 7/213 . . . Exposición simultánea con el mismo motivo luminoso de diferentes zonas de la misma superficie (G03F 7/207 tiene prioridad) [**4, 2006.01**]
- 7/22 . . . Exposición sucesiva con el mismo motivo luminoso de diferentes zonas de la misma superficie (G03F 7/207 tiene prioridad) [**1, 4, 2006.01**]
- 7/23 . . . . Dispositivos automáticos para este efecto [**4, 2006.01**]
- 7/24 . . . Superficies curvadas [**1, 2006.01**]
- 7/26 . . Tratamiento de materiales fotosensibles; Aparellaje a este efecto (G03F 7/12-G03F 7/24 tienen prioridad) [**3, 5, 2006.01**]
- 7/28 . . . para obtener imágenes por espolvoreado (G03F 3/10 tiene prioridad) [**5, 2006.01**]
- 7/30 . . . Eliminación según la imagen utilizando medios líquidos [**5, 2006.01**]
- 7/32 . . . . Composiciones líquidas a este efecto, p. ej. reveladores [**5, 2006.01**]
- 7/34 . . . Eliminación según la imagen por transferencia selectiva, p. ej. por arrancamiento [**5, 2006.01**]
- 7/36 . . . Eliminación según la imagen no cubierta por los grupos G03F 7/30-G03F 7/34, p. ej. utilizando una corriente gaseosa, un plasma [**5, 2006.01**]
- 7/38 . . . Tratamiento antes de la eliminación según la imagen, p. ej. precalentado [**5, 2006.01**]
- 7/40 . . . Tratamiento tras la eliminación según la imagen, p. ej. esmaltado [**5, 2006.01**]
- 7/42 . . . Eliminación de reservas o agentes a este efecto [**5, 2006.01**]
- 9/00 Colocación o posicionamiento de originales, máscaras, tramas, hojas fotográficas, superficies texturadas, p. ej. automático** (G03F 7/22 tiene prioridad; preparación de máscaras fotográficas G03F 1/00; en combinación con dispositivos de reproducción fotográfica para hacer reproducciones G03B 27/00) [**1, 4, 2006.01**]
- 9/02 . . combinados con medios de enfoque automático (enfoque automático en general G02B 7/09; sistemas para la generación automática de señales de enfoque G02B 7/28) [**4, 2006.01**]